

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和4年5月24日(2022.5.24)

【公開番号】特開2020-13983(P2020-13983A)

【公開日】令和2年1月23日(2020.1.23)

【年通号数】公開・登録公報2020-003

【出願番号】特願2019-91272(P2019-91272)

【国際特許分類】

H 01 L 21/683(2006.01)

10

H 01 L 21/3065(2006.01)

H 01 L 21/31(2006.01)

H 02 N 13/00(2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 R

H 01 L 21/302101 G

H 01 L 21/31 B

H 02 N 13/00 D

【誤訳訂正書】

20

【提出日】令和4年5月16日(2022.5.16)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0011

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0011】

図1は、基板支持具140を有する例示的な処理チャンバ100である。処理チャンバ100はチャンバ本体104を含み、チャンバ本体104に蓋102が連結されて処理空間112が画定される。ガス源116からチャンバ本体104の内部へと処理ガスを供給する処理ガス入口ポート114が、蓋102を貫通して形成され得る。チャンバ本体104の下方では、軸106が開口部110を通過して処理空間112内に延伸している。軸106は、基板支持具140と連結しこれを支持する。基板支持具140上に基板Wが配置されて示されている。基板Wは、平面ウエハや3次元(3D)積層ウエハであり得る。基板支持具140内に設けられた電極118に、軸106を通じて電源108が連結されている。電源108は、基板Wを基板支持具140へチャックするために、電極118にバイアスをかける。一例では、基板支持具140は静電チャックである。

30

40

50